

日本学術振興会
プロセスシステム工学第143委員会
第172回委員会議事録

1. 日 時： 平成21年7月24日（金）13：00～13：20

2. 場 所： 東京 ハーモニーホール （東京都千代田区内神田1-16-9）

3. 出席者：55名（順不同，敬称略）

委員長：長谷部伸治（京都大学）

委員：響 義則（住友化学），小西信彰（横河電機），篠原和太郎（東芝），高田晴夫（代理：山中史彦，三菱化学エンジニアリング），平尾雅彦（東京大学），渕野哲郎（東京工業大学），橋本芳宏（名古屋工業大学），加納 学（京都大学），伊藤利昭，梅田富雄（青山学院大学），北島禎二（東京農工大学），栗本英和（名古屋大学），黒岡武俊（富山大学），武田和宏（静岡大学），殿村 修（京都大学），瀧口孝司（名古屋工業大学），松本秀行（東京工業大学），菊池康紀（東京大学），橋爪 進（名古屋大学），村上佳広（関西大学），佐渡友秀夫（製品評価技術基盤機構），越島一郎（名古屋工業大学），大田原健太郎（クレハ），重政 隆（東芝三菱電機産業システム），坂本英幸（横河電機），馬場一嘉（ダイセル化学工業），村山 大（東芝），西野由高（代理：鈴木勝幸，日立製作所），杉浦彰俊（森永エンジニアリング），薄 豊文（代理：南波良行，ジャパンエナジー），西澤 淳（代理：島廻昭朗，三菱化学），竹田浩伸（代理：大山 敏，三菱化学），坂井 幹（山武），小松規秀（カネカ），藤田宗宏（三井化学），小尾秀志（森永乳業）

委員以外の出席者：宮澤由美子（東洋ビジネスエンジニアリング），大澤裕司（東洋ビジネスエンジニアリング），石田弘秋（三菱化学エンジニアリング），笠井（三菱化学エンジニアリング），河内伸仁（岩井機械工業），四元和隆（横河電機），水上 正（山武），古市和也（日揮），藤原幸一（京都大学），後藤田雅宏（日立ハイテクコントロールシステムズ），横井博志（横河電機），脇山 昇（横河電機），宮地利雄（JPCERT コーディネーションセンター），福田 稔（三井化学），森山 梢（三菱化学エンジニアリング），大塚 崇（三菱化学エンジニアリング），河野浩司（三菱化学エンジニアリング），菅野峰明（東京インキ）

4. 委員会

- 1) 委員長による挨拶
- 2) 次回以降の研究会およびPSE関連会議の案内（資料#1）
- 3) 平成20年度収支決算報告・承認，平成21年度収支予算承認（資料#1）
- 4) 国際会議報告 FOCAPD2009（殿村委員・資料#1），ADCHEM2009（加納委員・資料#1）
- 5) 本日の研究会スケジュールの説明

資料#1：第172回委員会・平成21年度第1回研究会

以上